COPYRIGHT: 1991, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

03005495

January 11, 1991

MODIFIED PHOSPHORAMIDITE PROCESS FOR PRODUCING MODIFIEDNUCLEIC ACID

INVENTOR: SELIGER HEINZ-HARTMUT; BERNER SIBYLLE; MUEHLEGGER KLAUS; VON DER ELTZ HERBERT; BATZ HANS-GEORG

APPL-NO: 02132429

FILED-DATE: May 22, 1990

PRIORITY: May 24, 1989 - 89 3916871, Germany (DE)

ASSIGNEE-AT-ISSUE: BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

PUB-TYPE: January 11, 1991 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: C 07H021#4

IPC ADDL CL: G 01N033#50

CORE TERMS: nucleotide, formula, detectable, sequence, modified, compd

ENGLISH-ABST:

NEW MATERIAL: A nucleotide sequence represented by formula I [wherein K is H, nucleotide, etc.; J is an OH group, nucleotide, etc.; B is a (modified) nuclear base; T is H, a lower alkyl, azide, etc.; X is O or S; L is a (n+1) valent corsslinking group; U is O, S, N or N-H, n is 1-200, W is a detectable group or a group changeable to the detectable group].

EXAMPLE: 5'-O-dimethoxytrityl-2'-deoxythymidine-3'-O-[2-(9- fluorenylmethoxycarbonyl)aminoethyl]-N,N-diisopropylamino-phosphone.

USE: A reagent for producing modified nucleic acid.

PROCESS: For example, a nucleotide sequence represented by formula II is reacted with a compd. represented by formula Y-W (wherein Y is a reactive group) (e.g. 2-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminoethyl-N, N-diisopropylaminophosphochloridite] to obtain the compd. represented by the formula I.

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平3-5495 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)1月11日

C 07 H 21/04 G 01 N 33/50

ZP

7822-4C 7055-2G

審査請求 有 請求項の数 12 (全15頁)

69発明の名称

修飾された核酸を製造するための修飾されたホスホルアミダイト法

頭 平2-132429 创特

願 平2(1990)5月22日 22出

優先権主張

図1989年5月24日図西ドイツ(DE) 19 39 16 871.9

70発 明 者

ハインツーハルツムー

ドイツ連邦共和国7915エルヒンゲン - タルフインゲン、ハ

ーゼンヴエーク1番

シピレ・ベルネル

ドイツ連邦共和国8900アウグスブルク、ゲーテストラーセ

勿出 願 人 ベーリンガー・マンハ

イム・ゲゼルシヤフ ト・ミツト・ペシユレ ンクテル・ハフツング

ト・ゼーリゲル

ドイツ連邦共和国6800マンハイム31、ザントホーフアース トラツセ116番

四代 理 人 、 弁理士 青 山

外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

修飾された核酸を製造するための修飾されたホ スホルアミダイト法

2. 特許請求の範囲

(1) 式(!X):

[式中、

Kは、水素原子、または別のヌクレオチドもし くはヌクレオチド配列のリン酸エステル残基のリ ン原子であり、

Jは、ヒドロキシル基、または別のヌクレオチ ドもしくはヌクレオチド配列の5'位の酸素原子 であり、

Bは、天然のまたは後節された核塩基であり、 Tは、水素原子、低級アルキル器、アジド基、 低級アルキルオキシ基またはヒドロキシル基であ ŋ.

Xは、酸素原子または硫黄原子であり、 しは、(n+1)価の架構結合基であり、 Uは、酸素原子、硫黄原子、窒素原子またはN ーHであり、

nは、1~200の自然数である] で示されるヌクレオチド配列を、式(N):

$$Y - W$$
 (N)

〔式中、

Yは、反応性益であり、

Wは、検出可能な基または検出可能な基に変化 し得る基である]

で示される化合物と反応させることを特徴とする、 式(V):

【式中、

Kは、水素原子、または別のヌクレオチドもし

くはヌクレオチド配列のリン酸エステル残基のリン原子であり、

」は、ヒドロキシル基、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列の5'位の酸素原子であり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Tは、水素原子、低級アルキル基、アジド基、 低級アルキルオキシ基またはヒドロキシル基であ り、

Xは、酸素原子または硫質原子であり、

しは、(n+1)価の架橋結合基であり、

Uは、酸素原子、硫酸原子、窒素原子またはN-Hであり、

Wは、検出可能な基または検出可能な基に変化 し得る基であり、

nは、1~200の自然数である] で示されるヌクレオチド配列の製造方法。 (2) 式(V):

し得る基であり、

がは、1~200の自然数である] で示されるヌクレオチド配列。

(3) 式([):

〔式中、

Aは、酸素原子保護基、ヌクレオテドまたはオリゴヌクレオチドであり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Xは、散象原子または硫黄原子であり、

しは、(n+1)価の架積結合基であり、

Tは、水来原子、低級アルキル基、アジド基、低級アルキルオキシ基または所望により保護されたヒドロキシル基であり、

Uは、酸素原子、硫黄原子、窒素原子またはN-Hであり、

Vは、開製し得る保護基であり、

[式中、

Kは、水素原子、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列のリン酸エステル残基のリン原子であり、

」は、ヒドロキシル基、または別のヌクレオチド配列の5'位の酸素原子であり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Tは、水素原子、低級アルキル基、アジド基、 低級アルキルオキシ基またはヒドロキシル基であ り、

Xは、酸素原子または硫黄原子であり、

Lは、(n+1)価の架橋結合基であり、

Uは、酸素原子、硫黄原子、窒素原子またはN-Hであり、

Wは、検出可能な基または検出可能な基に変化

nは、1~200の自然数であり、

Dは、第2アミン競技である]

で示される化合物を、遊離5'ーヒドロキシル基 を育する別のヌクレオシドと反応させ、ついで生 成したヌクレオテド配列を設化することを特徴と する式(以):

[式中、

Kは、水素原子、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列のリン酸エステル殺基のリン原子であり、

」は、ヒドロキシル基、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列の 5'位の酸素原子であり、

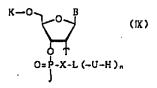
Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Tは、水素原子、低級アルキル基、アジド基、 低級アルキルオキン基またはヒドロキシル基であ р.

Xは、酸素原子または硫黄原子であり、 Lは、(n+1)値の架構結合基であり、 Uは、酸素原子、硫黄原子、空素原子またはN

Uは、酸素原子、硫質原子、整条原子またはN 一Hであり、

nは、1~200の自然数である] で示されるヌクレオチド配列の製造方法。

(4) 式(以):



[式中、

Kは、水素原子、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列のリン酸エステル残基のリン原子であり、

」は、ヒドロキシル基、または別のスクレオチドもしくはヌクレオチド配列の5°位の酸素原子であり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、

Tは、水素原子、低級アルキル基、アジド基、低級アルキルオキシ基、または所望により保護されたヒドロキシル基であり、

Uは、酸素原子、硫黄原子、窒素原子またはN-Hであり、

Vは、阴裂し得る保健益であり、

nは、1~200の自然数であり、

Dは、第2アミン残拡である]

で示されるヌクレオシドホスホルアミダイト。

(6) 請求項2に記載の式(V)で示される化合物 製造用の請求項5に記載の式(I)で示されるヌク レオンドホスホルアしダイト。

(7) 式(1):

[式中、

Aは、酸素原子保護基、ヌクレオテドまたはオリゴヌクレオチドであり、

Tは、水素原子、低級アルキル菇、アジド菇、低級アルキルオキシ茲またはヒドロキシル茎であ p.

Xは、酸紫原子または硫貨原子であり、

Lは、(n+1)価の架構結合拡であり、

Uは、酸紫原子、就食原子、窒素原子またはN-Hであり、

nは、1~200の自然数である] で示されるヌクレオチド配列。

(5) 式(1):

〔式中、

Aは、酸素原子保護基、ヌクレオチドまたはオ リゴヌクレオチドであり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Xは、酸素原子または硫貧原子であり、

しは、(n+1)値の架橋結合抵であり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Tは、水素原子、低級アルキル基、アジド基、 低級アルキルオキシ基、または所望により保護さ れたヒドロキシル基である]

で示される化合物を、式(皿):

[式中、

2は、良好な離脱越であり、

Xは、酸素原子または硫黄原子であり、

しは、少なくとも2価の架橋結合基であり、

Uは、酸素原子、硫黄原子、窒素原子またはN - Hであり、

Vは、開裂し得る保護語であり、

nは、1~200の自然数であり、

Dは、第2アミン残益である]

で示されるホスファンと反応させることを特徴と する請求項5に記載の式(【)で示されるヌクレオ シドホスホルアミダイトの製造方法。

(8) 式(11):

$$z-P \setminus_{D}^{X-L(-U-V)_{n}} (\mathbb{H})$$

〔式中、

2は、良好な難脱癌であり、

Xは、酸素原子または硫質原子であり、

しは、少なくとも2価の架橋結合基であり、

Uは、酸素原子、磁質原子、窒素原子またはN-Hであり、

Vは、阴裂し得る保健越であり、

nは、1~200の自然数であり、

Dは、第2アミン残酷である]

で示されるホスファン。

(9) 式(VI):

$$P(-Z)_{2} \qquad (VI)$$

[式中、2は良好な解脱基である] で示される化合物と、式(VI):

$$H - D$$
 (Y_1)

[式中、Dは第2アミン改基である] で示される第2アミンとを反応させ、得られた生 成物を、式(VI):

Jは、ヒドロキシル基、または別のスクレオチドもしくはスクレオチド配列の5'位の酸素原子であり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、

Tは、水素原子、低級アルキル基、アジド基、低級アルキルオキン選またはヒドロキシル基であれ

X、L、U、Wおよびnは、上記定義と同じである]

で示されるヌクレオチド配列に対して本質的に相 筋的であるヌクレオチド配列換出用の接式(V)で 示されるヌクレオチド配列。

(11) 試料DNAに対して相補的である核酸として、請求項2に記載の式(V)で示されるヌクレオチド配列を含むことを特徴とする試料に対して本質的に相補的である核酸と接触させることによる試料中の核酸の検出試薬。

(12) 二重領核酸の酵素合成におけるプライマー用の式(V):

 $H - X - L (-U - V), \qquad (VI)$

[式中、

Xは、酸素原子または硫質原子であり、

しは、(n+1)値の架橋結合器であり、

Uは、酸素原子、硫質原子、窒素原子またはN-Hであり、

Vは、開裂し得る保護益であり、

nは、t~200の自然数である]

で示される化合物と反応させ、得られた生成物を 単離することを特徴とする請求項8に記載の式 (面)で示されるホスファンの製造方法。

(10) 式(V):

[式中、

Kは、水素原子、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列のリン酸エステル段基のリン原子であり、

[式中、

Kは、水煮原子、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列のリン酸エステル残基のリン原子であり、

」は、ヒドロキシル基、または別のスクレオチドもしくはヌクレオチド配列の 5 位の酸素原子であり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 では、水素原子、低級アルキル基、アジド基、 低級アルキルオキシ基またはヒドロキシル基であ

X、L、U、Wおよびnは、上記定殺と同じである]

で示されるヌクレオチド配列。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、修飾された核酸を製造するための修 飾されたホスホルアミダイト法およびこの方法に 用いる新規な化合物に関するものである。 (従来の技術)

核酸は、世界中の生命にとって基本的に重要であり、したがって、全ての生物中に存在している化合物である。遺伝情報は、その核酸中に蓄積される。核酸配列が個々の生物について特徴的であるので、該核酸は、異なる種の生物の区別および固定に関する規準でもある。したがって、核酸の合成および検出が多く試みられてきた。

核酸は、化学的または酵素的に合成することができる。自然に生じるβ配置の核酸の化学合成によると、定義されたメクレオチド配列を有する、 技核酸を大量に製造することができるので、近年、 核化学合成は一層多く増加してきている。 該化学 合成は、特に、β配置のオリゴヌクレオチドの合成について、行うことができる。 別の方法は、使 用するヌクレオチドビルディングブロックのタイ プおよび配列中の隣接するヌクレオチドに結合さ

よって行われるべきであり、簡単な方法で、例えば低沸点を有する溶媒(例えば、ジクロロメタン) を用いてシリカゲルによって行うことはできない。

生成物が多くの有機溶媒に不溶であるという欠 点は、ホスホトリエステル法によって回避される。

ホスホトリエステル法では、反応性基を1つだけ有し、リン原子の繰りの2つのヒドロキシル基が異なる保護基で保護されているリン酸誘導体が用いられる。第1のヌクレオシドとの反応の後、保護基のうちの1つを開製し、次いで、形成されたヒドロキシル基を、第2のヌクレオシドとの反応のために活性化することができる。この方法の結果、活性化されたヌクレオシドホスフェートの収置を減少させる2つの追加の反応工程を、ヌクレオシドホスフェートにおいて行うことが必要である。

比較的高価な合成ピルディングブロックにおいて、より少ない反応工程で操作される特に優れている方法は、ホスホルアミダイト法として知られている[ゲイト、エム・ジェイ(Gait.N.1.)等、オ

せる反応工程によって区別することができる。

ホスホジェステル法では、カップリング試薬、 例えばトリアルキルアリルスルホン酸塩化物と共 に、リン酸エステル段越以外の全ての反応性基が 保護されているヌクレオシドーリン酸を、反応を 起こすべきヒドロキシル抵以外の全ての反応性抵 が保護されている別のヌクレオシドと反応させる。 主として、オリゴヌクレオチド鎖を構筑する縮合 工程中に、内部ヌクレオチド(リン酸エステル)結 合の非エステル化OH茲において望ましくない副 反応が生じ、複雑な反応混合物となるために、こ の方法における収率は低い。さらに、形成された リン酸ジエステルは、いくつかのプロトン性浴媒 にだけしか溶解することができず、該溶媒中でエ ステル化を行わなければならないという大きい欠 点を有している。ピリジン、ジメチルホルムアミ ドまたはジメチルスルホキシドのような溶媒は、 例えば、沸点が高いというような周知の欠点を有 している。ホスホジエステル誘導体の極性特性の 結果として、単離および精製は、イオン交換体に

リゴヌクレオチド・シンセシス: ア・プラクティカル・アプローチ(Oligonucleotide Synthesis: A Practical Approach)、IRL プレス(Press) オックスフォード(Oxford)]。この方法では、リン酸誘導体ではなくむしろ亚リン酸の誘導体、いわゆるホスホルアミダイト(phoaphoramidite) が用いられる。以下の話:

- 第1のヌクレオシドと結合することができる 反応性器、例えばハロゲン原子、
- 活性化の後に第2のヌクレオシドとの結合を 行うことができる第2アミノ茲、
- 保護基によって遮蔽されたヒドロキシル基を3種のリン原子に結合させる。

ホスホルアミダイト法の第1工程において、亚リン酸誘導体と、第1のヌクレオシドとを反応させる:この工程において、該ヌクレオシドは、反応性抵を関換する。第2工程において、第2アミノ越を第2のヌクレオシドによって選択的に避ら換える。該第2工程では、活性化試薬として、通常、テトラゾールが用いられる。次の工程におい

特開平3-5495 (6)

て、このメクレオチド配列を、例えばヨウ素を用いて酸化し、保護器を開製除去する。1つの変法としては、ホスホルアミダイト法が固相法として明示されている。この変法では、成長するメクレオチド配列を固相に結合させる。過期の合成試験およびピルディングブロックの分離ならびにオリゴヌクレオチド配列の精製は、この方法によって非常に開素化される。市販の入手可能な自動核酸合成器は、この方法に従って作動する。これらの構造は、例えば、ホスホルアミダイト法の特定の工程に適合している。

特に、生物学的試料中のDNAの特異的な検出 に、既知のヌクレオチド配列を有する核酸を適用 している。

このような検出法では、ある核酸と別の核酸の一重鏡が互いに相補的であるヌクレオチド配列を育しており、両者がリポースのC-1で同一の配置(αまたはβ)を有している場合には、ある核酸の一重鎖が別の一重機核酸と反応して、二重鎖を形成することができるという性質を利用している。

核酸を用いて核酸の量を測定する方法は、あまり 感受性が強くない。

したがって、EP-A 0173251において、完全な核酸の塩基が化学反応によって修飾されることが示唆されていた。しかし、このために、いくつかの核酸の反応工程が必要であり、修飾の割合は、核酸が遊離アミノ基を含む塩基を含有しているか否かに依存しており、この修飾は、相補的核酸とハイブリグイズする能力を損なわない。

ジェゲル(Jäger)等[パイオケミストリー(Biochemistry)、第27巻、第7237頁、1988年]には、リン原子に修飾を有するジヌクレオチドの製造が記載されている。該修飾は、リンカーを介して結合している第1 アミノ基からなっており、通常のホスホルアミダイト法と類似の方法に導入される。

しかし、この方法は、ホスホルアミダイトを使用する通常の自動合成器では行うことができない。 他の欠点は、遊離アミノ基が、これに使用する求 電子試薬と反応するので、もはや追加のヌクレオ チドと結合し得ないということである。 自然に生じる核酸は塩基類および軸類の結合に関 して月配置を有しているので、特に、月核酸は、 相補的核酸として考慮され得る。この二重額形成 方法は、ハイブリダイゼーションと称されている。

修飾された一道鏡の相補的核酸を、一道鏡核酸とのハイブリダイゼーションに用いると、二面鎖の形成を検出することができる。その後、例えば放射性機識であってもよい修飾によって、ハイブリダイズされた核酸の量を測定する。

修飾された核酸の合成に関して、既に入手可能 である天然の核酸を化学的もしくは酵素的に修飾 することができるか、または既に修飾されたヌク レオチドビルディングプロックの助けによってヌ クレオチド配列を合成することができる。

しかし、例えば、WO86/07363において5°-末端について示唆されているように、既に完全に合成された核酸の末端を修飾することによって、一重鎖あたり修飾されたヌクレオチドを1つだけ含む核酸を製造することができる。したがって、プローブとしてこのクイプの修飾された

したがって、入手可能な従来技術の方法は、それぞれ、かなりの欠点を育している。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、既知の方法の欠点を回避すること、 さらに詳細には、高い収率を有し、いくつかの反 応工程において簡単な出発物質で行うことができ るリン酸エステル吸基の位置で修飾された8配置 の核酸の固相上における合成方法を利用可能にす ることを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、ヌクレオシドホスホルアミダイトを、 遊離ヒドロキシル基を有する別のヌクレオチドと 反応させ、ついでリン酸エステルに形成されるヌ クレオチド配列を酸化することを特徴としており、 該ヌクレオシドホスホルアミダイトとして式(1):

[式中、

特別平3-5495 (ア)

A は、砂索原子保護基、ヌクレオテドまたはオ ・ リゴヌクレオチドであり、

> Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Xは、酸素原子または硫質原子であり、

Lは、(n+1)価の架板結合基であり、

Tは、水柴原子、低級アルキル茲、No. 低級アルコキン、または所望により保証されたヒドロキンル茲であり、

Uは、敗衆原子、硫黄原子、窓衆原子またはN -Hであり、

Vは、阴裂し得る保護店であり、

nは、1~200の自然数であり、

Dは、第2アミン残態である]

で示される化合物を使用する、式(以):

[式中、

Kは、水素原子、または別のヌクレオチドもし

第67巻、第673頁~第684頁によって、本質的には知られている。本発明の方法は、特に、式(I)で示される別のヌクレオシドホスホルアミグイトを出発物質として用いる従来技術の方法とは異なる。

式(!)における残基人は、好ましくは、酸素原子保護基である。ヌクレオチド合成において5'-ヒドロキシル基の保護に適している保護基は、公知である。酸性条件下で開裂することができるトリフェニルメチル基またはジメトキシトリフェニルメチル基のような保護基が非常によく用いられる。

残基Aがヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドである場合、それは天然のまたは修飾されたヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドのいずれであってもよい。オリゴヌクレオチドを用いる合成はより困難であるので、オリゴヌクレオチドよりもヌクレオチドのほうが好ましい。残甚Aのヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドは、本発明によって製造される残甚であってもよい。残甚Aの

くはヌクレオチド配列のリン酸エステル残基のリ ン原子であり、

」は、ヒドロキシル茲、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列の5'位の酸素原子であり、

Bは、天然のまたは怪飾された核塩基であり、 Tは、水素原子、低級アルキル基、アジド基、 低級アルキルオキシ基またはヒドロキシル基であ り、

Xは、酸素原子または硫質原子であり、 しは、(n+1)価の架積結合基であり、 Uは、酸素原子、硫質原子、窒素原子またはN -Hであり、

nは、1~200の自然数である] で示されるヌクレオチド配列の製造方法を提供するものである。

低級アルキル基および低級アルコキシ基は、炭 素原子を1~6個、好ましくは1~4個有する。 いわゆるホスホルアミダイト法による核酸の製 造方法は、例えば、ビオシミィ(Biochimie) 1985、

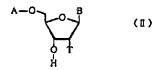
ヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドの反応性 基を適当な保護法によって保護するのが好ましい。 特に、残益人のヌクレオチドまたはオリゴヌクレ オチドの末端の5'ーヒドロキシル基を酸紫原子 保護基によって保護する。この酸素原子保護基は、 特に、残益人について上述した定義を有する。

残基Bの天然の核塩基は、好ましくは、アデニン、チミン、シトシン、ウラシルまたはグアニンである。修飾された塩基は、例えば、それらの構造を環または置換基において変化させた塩基であってもよい。例えば、アーデアザグアニンまたは5ーアミノアルキルウラシルまたは8ーアミノヘキシルーアミノーアデニンが挙げられる。これらの塩基は好ましく、核塩基において相補的核酸のとワトソン-クリック塩基対に全く影響を与えないか、または極値かだけに影響を与えるだけである。

残落下は、リポまたはアラビノ配型を有し得る。 好ましくは、リポ配置である。均落性、酸性また は求核条件下で開裂することができる基、好まし くは、tープチルジメチルシリル様またはトリイ ソプロビルシリル基は、ヒドロキシル茲に関する 保護基として使用することができる。

保修越Vは、選択的に開裂し得る保護基であるのが好ましい。完全なヌクレオチド配列を固形担体から開裂する条件下で同時に開裂し得る保護基が好ましい。したがって、例えば残基人において記載したような酸性条件下で開裂し得る保護基は、好ましくない。故に、アルカリまたはアンモニア条件下で開裂し得る保護基が特に好ましく、フルオレニルメトキシカルボニル基またはトリフルオロアセチル基が特に好都合であることが確認された。

式(1)で示される化合物は、式(1):



〔式中、

Aは、酸素原子保護拡、ヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドであり、

の条件が当集者によって選択され得る。しかし、 この方法において、試薬を用いる場合は、保護基 Vを開裂し得る試薬を用いないように注意しなけ ればならない。個々の保護基に関するこれらの反 応条件は、当業者に知られている。

式(皿)で示されるホスファンは、簡単な方法で、 市阪の入手可能な出発物質から合成され得る。好 ましい製造方法において、第2アミンがより安価 な粗製物質であるが故に、第2アミンとの反応が 最初に計画される。この反応工程において、必要 であれば、非特異的な反応による収率の減損は容 認し得る。式(皿)で示されるホスファンは、好ま しくは、式(VI):

$$P(-2)_{a} \qquad (VI)$$

[式中、2は良好な離脱基である] で示される化合物と、式(VI):

[式中、Dは郊2アミン銭誌である] で示される郊2アミンとを反応させ、得られた生成物を、式(VI): Bは、天然のまたは旋飾された枝塩基であり、 Tは、水素原子、(所望により保護された)ヒド ロキシル茲、低級アルキル茲、N,または低級ア ルキルオキシ茲である]

で示される化合物を、式(Ⅱ):

$$Z-P \setminus D$$
 (II)

[式中、 .

2は、良好な離脱盐であり、

Xは、酸紫原子または硫黄原子であり、

しは、少なくとも2師の架根結合揺であり、

Uは、酸素原子、硫数原子、変米原子またはN-Hであり、

Vは、閉裂し得る保護語であり、

nは、1~200の自然数であり、

Dは、第2アミン残茲である]

で示されるホスファンと反応させることによって 製造することができる。

該反応条件としては、従来技術のヌクレオシド ホスホルアミダイトについて既述した条件に類似

$$H - X - L (-U - V)_n \qquad (VII) \quad .$$

[式中、

Xは、酸素原子または硫黄原子であり、

しは、(カ+1)師の架構結合基であり、

Uは、胶索原子、硫質原子、窒素原子またはN-Hであり、

Vは、開裂し得る保護基であり、

nは、1~200の自然数である]

で示される化合物と反応させ、形成された生成物 を単離することによって製造される。 残基2は、 好ましくはハロゲン原子であり、特に好ましくは 塩素原子である。

式(切)で示される化合物は、特に、式:

[式中、R *およびR*は、同一または異なっており、1~10個の炭素原子を有する第1、第2または第3アルキル基であるか、または所望により、一緒に、ヘテロ原子として1または2つの窓素原子、酸素原子および/または硫黄原子を含有し得る5~7個の炭素原子を有するアルキル分核鉛伏

特開平3-5495 (9)

シクロアルキル基を示すか、またはNR¹R¹はイ ミダソリル弦、トリアソリル茲、テトラソリル茲、 3ーニトロー1.2.4ートリアソリル茲、チアソ リル茲、ピロリル茲、ベンソトリアソリル茲もし くはベンソヒドロキシトリアソリル茲である] で示される、当集者に知られている第2アミンで ある。ジイソプロビルアミンおよびモルホリンが 特に好ましいアミンであることが確認されている。

在し得る2'ーヒドロキシル茲は、tープチルジメチルシリル茲によって保護されているのが好ましい。遊離ヒドロキシル茲は、額残茲の5'ーヒドロキシル茲であるのが好ましい。

技ヌクレオシドは、本発明の方法で修飾されたヌクレオシドであってもよい。

その後、固相に結合したヌクレオチド配列 を酸化する。ヨウ索が好ましい酸化剤である ことが確認されている。

次に、キャッピング工程(capping step)を 行うのが好ましい。これは公知の方法に従っ て行われる。 しなければならない。核架橋結合抵は、n個の共 符結合を介して、n個の抵Uと結合する。nの数 は、1から200までが好ましい。

式(皿)で示される化合物は、核酸のホスホルア ミダイト合成用のヌクレオシドホスホルアミダイ トの合成に用いることができ、かつ保護された形 の反応性甚を有する、従来技術のホスファンに比 べて優れており;これは、検出可能な基に関する 結合部位として作用することができる。

ヌクレオチド配列の製造に関する本発明の方法 は、特に、下記工程を含む:

式(!)で示されるヌクレオシドホスホルア ミダイトと、遊離ヒドロキシル基を有するヌ クレオチドとのカップリング反応。遊離ヒド ロキシル基を有するヌクレオシドは、固形担 体に共有結合されるのが好ましい。アミノ基、 カルボニル抵または別のヒドロキシル基のよ うなヌクレオシドの別の反応性基は、カップ リング反応の条件下で安定である保証基によっ て保護されているのが好ましい。糖発基に存

保護基人または残落人のメクレオチドまた はオリゴヌクレオチドの末端5'ーヒドロキ シル基の酸素原子保護基の選択的開裂。好ま しい場合において、残益人の酸素原子保護基 が酸性条件下で開裂し得るジメトキシトリフェ ニルメチル基のような保護基である場合、そ れは、例えば、ジクロロ酢酸によって開裂され得る。

ここで、所望により、これら第1の工程を 級り返すことができる。これに関して、モノ ヌクレオシドホスホルアミダイトとして、慣 用のモノヌクレオシドホスホルアミダイトま たは式(1)で示されるモノヌクレオシドホス ホルアミダイトを用いることができる。

ヌクレオチド配列が所望の長さに違すると すぐに、保護基Vを開裂する。アミノ保護誌 の場合、トリフルオロアセチルまたはフルオ レニルメトキシカルボニル茲(Face)が特に 優れていることが確認されている。

その後、既知の方法で固形担体からヌクレ

オチド配列を開製する。この条件は、共有結 合のタイプに応じて選択され、本発明の修飾 によっては影響されない。

しかし、これらの条件としては、保護越Vの開裂および担体からのヌクレオチド配列の開裂が同時に行われる条件が特に好ましい。これは、例えば、3'-O-スクシニルを介してCPG[制御されたポアガラス(controlled pore glass)]に結合した担体および残越VとしてのFnoc保護基の利用によって行うことができ、これには、開裂試薬として、アルカリ、好ましくは濃アンモニア水溶液またはアミン溶液が用いられる。

通常、次に、精製工程、例えばHPLCクロマトグラフィーまたは/および透析による精製が行われる。一般的にオリゴヌクレオチド合成に用いられるのと同一の条件が適用される。

これら全ての工程は、別のヌクレオシドホスホ ルアミダイトが用いられ、リン酸エステル残拡の

を存する。

例えば、ヌクレオチド配列は、簡単な方法で、 検出可能な基または検出可能な基に変化し得る基 を育する、本発明方法で製造した式(IX)で示され るヌクレオチド配列から製造することができる。 ヌクレオチド配列がいくつかの修飾されたヌクレ オチドビルディングブロックを育する場合、この ような基をいくつか含有するヌクレオチド配列を 製造することができる。結果として、核酸の測定 がより高感度になることが確認されており、この ために、この方法は好ましい。

さらに、本発明は、上記工程の後に、形成された式(IX)で示されるスクレオチド配列と式(IV):

$$Y - W$$
 (W)

[式中、

Yは、反応性益であり、

Wは、検出可能な基または検出可能な基に変化し得る基である]

で示される化合物とを反応させることからなる、 式(V): 酸素原子保健基を開裂するための試薬の代わりに 保護基との開製用の既存の試薬が用いられるとい う事は別にして、この方法の慣用の反応経路の変 化を必要としないという共通点を有する。特に、 工程の数は、慣用のホスホルアミダイト法と同じ であるかまたはそれよりも少ない。すなわち、本 発明の方法は、装置を変えずに、ホスホルアミダ イト合成用の入手可能な核酸合成器で行うことが できる。

この方法で製造される式(IX)で示されるヌクレオチド配列は、好ましくは2~200、特に好ましくは2~200、特に好ましくは20~60のヌクレオチドビルディングブロックを有する。ヌクレオチドビルディングブロックの10~80%、特に好ましくは20~50%は、リン原子の位置で修飾された式(1)で示されるヌクレオシドーリン酸から形成されたヌクレオチドビルディングブロックである。これらの修飾されたヌクレオチドビルディングブロックは、配列中で互いに2~5ヌクレオチド間隔であるのが好ましい。式(IX)で示される化合物は多くの用途

[式中、

Kは、水烙原子、または別のヌクレオチドもしくはヌクレオチド配列のリン酸エステル残基のリン原子であり、

」は、ヒドロキシル越、または別のスクレオチドもしくはヌクレオチド配列の5°位の酸素原子であり、

Bは、天然のまたは修飾された核塩基であり、 Tは、水常原子、低級アルキル基、アジド基、 低級アルキルオキシ語またはヒドロキシル基であ り、

Wは、検出可能な基または検出可能な基に変化 し得る基であり、

X、 L、 Uおよび n は前記定義と同じである) で示される ヌクレオチド配列の製造方法を提供するものである。

特開平3-5495 (11)

容易に置換することができる求核基、または求 電子基は、例えば、反応性基Yとして使用するこ とができる。式(N)で示される化合物は、例えば、 カルボン酸ハロゲン化物である。

求電子基は、例えば、活性化エステルまたは無水物中の基である。これらがカルボキシル基である場合、好ましいエステルは、例えば、ハブテンのN-ヒドロキシスクシンイミドエステルである。

残据KまたはJの定義に含まれる別のヌクレオチドは、天然のまたは修飾されたヌクレオチドであってよい。残器KまたはJの定義に含まれるヌクレオチド配列は、天然のおよび修飾されたヌクレオチドビルディングブロックを含有し得る。式(V)で示されるヌクレオチド配列は、好ましくは20~60のヌクレオチドビルディングブロックを有する。ヌクレオチドビルディングブロックの10~80%、特に好ましくは20~50%は、式(I)で示されるヌクレオシドーリン酸から形成されたヌクレオチドビルディングブロックである。

によってプライマーとして受け入れられる。 修飾は、例えば複残茲もしくは塩基の別の修 節、または3'-もしくは5'-末端標識に付 加的に生じる。

接方法は、必要なビルディングブロックの集中合成(convergent synthesis)を含む。このような方法は、特に高価なヌクレオチドビルディングブロックの収率を高く維持することができるので、特に優れている。

容易に入手でき、自然に生じる8ヌクレオシドをヌクレオシドホスホルアミダイトの合成 に用いることができる。

リン酸エステル基の位配で修飾されたメクレ オチド配列を合成するために、同一または減 少した反応工程の数と共に、メクレオチド配 列の合成のための固根ホスホルアミダイト法 の周知の長所を利用することができた。

本発明の方法を用いて、配列における全く特定の部位で非常に特定数の修飾を導入することができる。

製基Wは、低分子構造および高分子構造であってよい。好ましい低分子のレポーター分子は色素およびハブテンであり:好ましい高分子群は、例えば、酵素、または抗原もしくは抗体のような免疫学的に活性な物質である。特に好ましくは、ハブテンである。例えば、ジゴキンゲニンのような体液中で通常の条件下では生じないものが特に好ましい。ハブテンおよび特に好ましいジゴキシゲニンは、これらを有するヌクレオチド配列の分子型が修飾によってあまり変化せず、例えばゲルクロマトグラフィーにおいて、長さの様準として用いることができるので、免疫学的に活性な物質として特に優れていることが確認されている。

きらに、ヌクレオチド配列の構築に関する本発 明方法は、従来技術と比較して以下の優れた点を 有していることがわかった:

修飾がリン原子の位置で生じるので、相補的 ヌクレオチド配列と共に形成されたヌクレオ チド配列の塩基対は損なわれない。

形成されたヌクレオチド配列はポリメラーゼ

一般に、形成された修飾されたメクレオチド 配列を用いることができる。例えば、異なる 検出可能な基を選択することができる。

検出可能な基がヌクレオシドホスホルアミダイトに最初から存在しないので、酵素標識または別の感受性レポーター基を用いる場合に 予想されるヌクレオチドの化学合成の間の複雑化が回避される。

レポーター分子による立体障害は、オリゴヌ クレオチド合成の収率および効率を減少する ことがある。この欠点は、本発明の方法で回 避される。

試料中の核酸に本質的に相簡的である核酸と試料との接触、他方に相簡的である核酸のハイブリダイゼーションを生起させる条件下での該混合物の処理および検出可能な基の検出による試料中の核酸の検出方法において、式(V)で示されるメクレオチド配列は、試料DNAに相簡的なメクレオチド配列として好都合に用いることができる。検出可能な接の検出は、既知の方法によって行うこ

特閒平3-5495 (12)

とができる。検出可能な基が免疫学的に活性な物質である場合、該基は、標識化された免疫学的パートナーと反応し得る。その後、標識を測定する。本発明の核酸利用の場合、基Wとして、ハブテン、特にジゴキシゲニンが好ましい。

これらは、一重鎮核酸から二重鎮核酸への酵素 的合成におけるプライマーとして同等に好適であ る。形成された二重鎖核酸は、2つの鎖のうちい ずれか一方にヌクレオチド配列を含有している。 (実施例)

以下の実施例によって、本発明を説明する。 実施例 <u>1</u>

2-(9-フルオレニルメトキンカルポニル)ア ミノエタノール

容量 1 4の丸底フラスコ中、撹拌しながら、ジオキサン300 mgに 8 ーフルオレニルメトキシカルボニルーNーヒドロキシスクシンイミドエステル)(F moc-O-Su) 6 8.0 g(約200ミリモル)を溶解した。該透明溶液に、水200 mgに溶解したNa,CO,40 gおよびエタノールアミン14.

内で滅下し、温度を約~80~-85℃に維持した。 承加終了後、濃いパルプ状反応混合液を窒温にし、低水エーテル約600mlで看釈して、さらに撹拌し易くした。 室温でさらに3時間撹拌した後、形成した沈殿物をガラスフィルターで吸引遊込し、エーテルで数回洗浄した。常圧でエーテルを排水した後、水流ポンプ(vater-jet vacuum)で未反応PClm、ジイソプロピルアミンおよびピリソンを除去し、次いで、段存した油状物をオイルーポンプパキューム(oil-pump vacuum)(K・48℃/0.35Torr)で分別蒸留した。 理論収量の36%に相当するホスファン73.49を得た。

3 1 P - NMR (ppa) (CHC (2): 167.5。 <u>実施例3</u>

2-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)ア ミノエチルーN, N - ジイソプロピルアミノーホ スホクロリダイト

容量 I O O zeの丸底フラスコ中、無水テトラヒドロフラン 3 O zeにジクロローN, Nージイソプロピルアミノーホスファン O, 9 ze(5 ミリモル)

4 mQ(238ミリモル)を連続して添加した。すぐに形成したパルプ状(pulpy)反応混合液を、窒温で一晩似枠し、翌日、吸引適過した。未反応のFmoc-O-Su、N-ヒドロキシスクシンイミドおよび目的生成物を含有する適過残渣を酢酸エステルから再結晶した。減圧乾燥した後、純な生成物47.4g(理論収量の78%)を得た。

'H-NMR (ppm)(DMSO): 3.4(m、CH₂O、2H); 3.6(t、CH₂H、2H): 4.2-4.5(m、CH₂OCO + H {C9}, 2H): 5.2(m [b]、NH、1H): 7.2-7.9(m、芳香族、8H)。

实施例2

<u>ジクロローN, N-ジイソプロビルアミノーホ</u> スファン

容量500mをの額下翻斗、KPGスグーラー、 温度計およびアセトン/ドライアイス浴を装掛した容量20の3つ口丸底フラスコ中、撹拌しながに ら、脈水エーテル300ml、無水ピリジン81ml およびPCQ、87.5ml(1モル)を-70℃に予 め冷却した。それに無水エーテル250ml中ジイ ソプロピルアミン142ml(1モル)を、2時間以

を溶解し、これに無水ビリジン0.4 m2を添加した。磁気的に撹拌しながら、この混合液に、無水テトラとドロフラン20 m2に2-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)アミノエタノール(5ミリモル)1.4 gを溶解した溶液を、約5時間、ゆっくりと滅下した。テトラヒドロフランを分離および排水したビリジン・塩酸塩を吸引&過した後、残存した油状物(2.2gー理論収量の98%)を、ヌクレオシドホスホルアミグイトの製造に直接用いた(実施例4参照)。

爽施例 4

5'-O-ジメトキシトリチル-2'-デオキシ チミジン-3'-O-[2-(9-フルオレニルメ トキシカルボニル)アミノエチル]-N,N-ジイ ソプロピルアミノ-ホスファン

a) 容量100mlの丸底フラスコ中、ジクロロメタン(NacCOoで基型した)50mlおよびNーエチルーN,Nージイソプロピルアミン2.5mlに5'-Oージメトキシトリチルー2'ーデオキシチミジン2.5g(4.6ミリモル)を溶解した。使い

捨て注射器を用いて、これに2-(9-フルオレニルメトキシカルポニル)アミノエチルーN,N-ジイソプロピルアミノーホスホクロリダイト2sd (約5ミリモル)を加えた。 窒温で48時間撹拌し、減圧下で蒸発させ、粘稠性の残留物を得た。

租生成物をシリカゲル80[カラム30×2cm、移動溶似:石油エーテル50~70℃/酢酸エチル/ジクロロメタン/ピリジン(4:8:8:2)]によるクロマトグラフィーによって精製した。生成物を含有する画分を集め、溶媒を完全に減圧除去した。

理論収量の20%に相当する白色の泡状吸留物 0.9gを得た。

b) 別法として、撹拌しながら、無水ジオキサン100m2に5'-O-ジメトキシトリチル-2'-デオキシチミジン5.45g(10ミリモル)を溶解した。この溶液に、ハンモト(S. Heanoto)、タカク(H. Takaku)[ケミストリー・レターズ(Chemis Lry Lett.)、1986、1401-1404]に従って調製したビスー(ジイソプロビルアミノ)-クロロホスファ

去した後、越液を機糖した。租生成物を、シリカゲル60H[2=24cm、d=4cm;移動溶媒:塩化メチレン/酢酸エチル(5:1)]によるクロマトグラフィーによって精製した。溶媒の除去後、無色の泡状物を再度得た。これを塩化メチレン10m2中に取り、水冷したn-ヘキサン400m2によって沈澱させた。理論収量の30%に相当する無色粉末の目的生成物1.8gを得た。

2つのジアステレオマーは、TLCおよび31 P-NMRによって識別することができる。

R (値(CH₂C2₂/EA-1:1):0.04、0.15。 3 i P-NMR (ppm)(CD₂CN):146.7、145.8。 <u>実施例5</u>

d(Tp_mTpTpTpTpTpTpTpxxT)の合成

オリゴヌクレオチドの合成は、パイオサーチ・カンパニー(BioSearch Company)から入手した完全自動 DNAシンセサイザー8800において標準的なプロトコールに従って1マイクロモルの大きさで行った。合成装置は、1マイクロモルのチミジン担体で被覆された反応カラムを装替してお

ン2.78(10ミリモル)、およびトリエチルアミ ン2.1 ml(15ミリモル)をジオキサン100 ml に熔解した溶液を、30分以内で滴下した。反応 の後、移動溶媒として塩化メチレン/酢酸エチル (1:1)を用いる聊届クロマトグラフィーにかけ た。 2時間後、保護アルゴンガス(protective ga s argon)の存在下、塩化トリエチルアンモニウム の沈殿物を越去し、越液を濃縮した(無色の泡状 物〉。さらに単離せずに、形成された5'-0-ジ メトキシトリチルー2'ーデオキシチミジンー3' ー〇ーピスー(N, N - ジイソプロピルアミノ)ホ スファンを目的生成物に転換した。これについて は、無色の泡状物を無水アセトニトリル100個 中に取り、2-(8-フルオンニルメトキシカル ポニル)アミノエタノール(実施例1)39およびテ トラゾール(昇雄した)35 ag(5ミリモル)を添加 した。室温で一晩撹拌し、酢酸エチル100㎏の 添加によって、反応を停止した。塩化ナトリウム 飽和水溶液で3回抽出した後、合わせた有機相を 硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濃

り、第1反応工程において、ジクロロメダン中2 %ジクロロ酢酸溶液で処理して、5'-OH保護 益(ジメトキシトリテルー)を明裂させた。 譲カラ ムをアセトニトリルで洗浄した後、本発明に従っ てP原子の位置で修飾された実施例4の5'-0 ージメトキシートリフェニルメチルー 2'ーデオ キシチミジンー3'-0-[2-(9-フルオレニ ルメトキシカルポニル)アミノエチル]ーN.N-ジイソプロピルアミノーホスファンと、出発ヌク レオシドの遊離 5′-0 H 抵とをカップリングし、 同時に、アセトニトリル中でテトラゾールによっ て活性化した。3個の形で存在したままであるP 原子を、洗浄を繰り返した後、THF/ルチジン /H∗Oにヨウ素を溶解した溶液で酸化すること によって、天然の5価のリン酸エステルに転換し た。次の係水酢酸/ジメチルアミノビリジンによ るキャッピング工程によって、アセチル化による 非-結合の5'-0H-ヌクレオシドを保護した。 この方法によって、正しくない配列の形成が抑制 された。洗浄後、5'-0-ジメトキシトリチル

保証基を繰り返し間裂することによって出発から 合成サイクルを再開した。この方法で、最終段階 におけるアミノエチル化チミジン-ホスホルアミ ダイト(Tpas)とおらにカップリングを行う前に、 非経師ホスホルアミグイト分子を有する8チミジ ンピルディングブロックを反応配列に導入した。 合成終了後、担体に結合したオリゴヌクレオチド を、鍵アンモニア水溶液による処理によって解放 し、これによって、同時にアミノエチル化リン酸 エステルのFac保護基が除去された。結果は、 86 ODU/A***であった。この粗製混合物を 以下の条件下でHPLCにかけた。

カラム:モノ(Mono)Q HR 10/10 [ファルマシア(Pharmacia)]。

溶雕液 A:水。

溶雕液B: 0.5N LiCe。

勾配被: 60分間でAから50%Bまで。 溶出液をH.Oに対して一晩遊析した[スペクト レーパー(Spektrapor)、MWCO 1000]。 収量: 55 ODU。

水中に取り、蒸留水に対して一晩透折した[スプレクトレーパー(Spreetrapor)、MWCO 100

収取: 11 ODU/A....

实施附7

DNA試験における検出限界の比較

HIVに対して特異的な配列を育する3つの同一のオリゴヌクレオチド(3 8 more)のハイブリダイゼーション特性を、クローンしたHIV-DN Aフラグメント(HIV-Wfl. 13-アイソレートのgag領域由来の954bp PvuI/BglIフラグメント)に対して試験した。オリゴヌクレオチドの下記部位を、ジゴキンゲニンで機識化した:

- それぞれ、5°-末端ウラシルおよび中央部 に位置するウラシル(すなわち、2つのディ グ標識(dig labels)、ウラシルのC-5での 塩基標識)、
- それぞれ、5'-末端、3'-末端および中央 部に位置するウラシル(すなわち、3倍のディ グ標識、ウラシルのC-5での塩基緑識)、

実施例 6

<u>ジゴキンゲニンによる実施例 5 からのオリゴヌ</u> クレオチドの模様化

0.1 m かり酸ナトリウム級街波 1 m2(pH 8.5) に実施例 5 からのオリゴマー 5 5 O D U / A 10 のを溶解し、ジメチルホルムアミド 1 m2にジゴキシゲニンー 0 ースクシニルーアミドカプロン酸ー N ーヒドロキシスクシンイミドエステル 1 0 mgを溶解した溶液と混合した。この混合液を窒温で 1 8 時間撹拌し、減圧下で蒸発乾固し、H 1 O に溶解し、生成物を含有する混合液を以下のHP L C で分離した:

カラム:シャンドン・ハイパーシル(Shandon Il ypérsil) ODS、25cm×0.4cm。

溶離液A:0.1m酢酸トリエチルアンモニウム 溶液。...

溶離液 B: 0.1 m酢酸トリエチルアンモニウム 溶液/イソプロパノール。

勾配液:30分間かけてAから50%Bまで。 生成物質分を、減圧下で蒸発によって機縮し、

3. それぞれ、5°-末端リン酸エステル残基および中央でに位置するリン酸エステル残基(本 発明に従って標識する、2つのディグ標識/ 分子)。

a)<u>ディグ標識を育するオリゴヌクレオチドのハ</u> <u>イブリダイゼーション</u>調製法

試料DNAを1μQの容量ずつ一連の希釈系にフィルクー上で直接スポットするか、または、アガロースゲル中で分離した後、フィルター上に、20xSSC級衝液を用いるサザーンブロットによって移した。3分間、UV照射によって固定化を行った。

フィルターを以下の条件下で予めハイブリダイ ズした: 5×SSC中、40℃で1時間、0.5 %保護試験。以下の条件下で、ディグ標識化した オリゴヌクレオチドとの次のハイブリダイゼーショ ンを行った: 5×SSC中、4℃で一晩、0.5 %保護試薬、ハイブリダイゼーション溶液1 xlx たりオリゴヌクレオチド200ng。

次いで、フィルターを、2×55C、0.1%

SDS中、40℃で10分間、4回洗浄した。 リゴキシゲニンに対するPOD-機識化抗体を 用いて、非放射性操識化および検出装置[ベーリ ンガー・マンハイム・ゲゼルシャフト・ミット・ ベシュレンクテル・ハフツング(Boehringer Kann heia GabH)]に類似の検出を行った。

b) 結果

スポット/ブロットされた試料DNAの校出限 界は、

- (1)2 倍塩基標識化オリゴヌクレオテドで I O
- (2)3 倍塩技振線化オリゴヌクレオチドで l O
- (3)リン酸エステルによって 2倍標識化された オリゴヌクレオチドで 1~ 1 Ong であった。

特許出願人 ベーリンガー・マンハイム・ゲゼル シャフト・ミット・ペシュレンクテル・ ハフツング

代 理 人 弁理士 青 山 葆 ほか1名

第1頁の続き

砂発 明 者 クラウス・ミユーレゲ ドイツ連邦共和国8121ポリンク、レーメルストラーセ7番ル
砂発 明 者 ヘルベルト・フオン・ ドイツ連邦共和国8120パイルハイム、イン・デル・アウ21 デル・エルツ 番
砂発 明 者 ハンスーゲオルグ・パ ドイツ連邦共和国8132トウーツインク、トラウビンゲルー フ ストラーセ63番